

高周波誘導加熱真空溶解炉 SVM-10000R



高周波誘導加熱真空溶解炉SVM-10000Rは誘導加熱式溶解炉で、Ni基やCr基を1000g(Ni換算)の容量まで溶解可能です。高周波電源は10KW9.9KHz仕様を採用しております。また添加バケットを5個標準装備しております。貴社・貴学のご要望に合わせて設計・製作可能ですので是非御相談ください。

高周波誘導加熱真空溶解炉SVM-10000R仕様

- 到達圧力 1.4×10⁻³Pa以下※常温・無負荷時
- 溶解量 1000g(Ni換算)
- 加熱温度 ~1650℃
- 溶解室径 φ600mm×600mmL SUS304 内面:酸洗処理 外面:焼付塗装
- 溶解機構 10KW9.9KHz
トランジスターインバータ方式高周波電源
マッチングボックス
高周波同軸電極
溶解コイル:内径φ95mm×128mmH/13巻(Si処理)
外ルツボ形状:φ85mm×φ73mm×100mmH(アルミナ)
内ルツボ形状:φ63mm×φ53mm×100mmH(アルミナ)
- 測温機構 B熱電対(特殊材質保護管付)
- 付帯機構 炉体傾注機構:手動ハンドル型
ブリッジブレーカー(先端部:W)
試料添加バケット:φ48.6mm×59mmH(5式)
- 真空排気系 油回転ポンプ:670L/min[50Hz]
メカニカルブースターポンプ:95m³/h[50Hz]
油拡散ポンプ:3400L/sec水冷バッフル付
- 真空計 デジタル連成計/ピラニ真空計/ペニング真空計
- ユーティリティ電気:AC200V三相20KVA
冷却水:14L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
寸法 装置架台本体:700mmW×(1000mm)D×(490mm)H
制御盤:570mmW×600mmD×1250mmH
排気装置:480mmW×820mmD×513mmH